ペニングイオン化電子分光による有機薄膜の分析

アブドゲニィ アブドレヒミ

2016年2月

新潟產業大学経済学部紀要 第46号別刷

BULLETIN OF NIIGATA SANGYO UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS

No.46 February 2016

ペニングイオン化電子分光による有機薄膜の分析

アブドゲニィ アブドレヒミ

Characterization of Organic Thin Films by Penning Ionization Electron Spectroscopy

Abuduaini ABDUREYIM

要旨

有機分子を薄膜状態で調べることは、ナノスケール構造を自己組織的に形成することや意図 的に構造を制御した集合体を造ることの基本となる。薄膜系の物性を考えると、それは膜を構 成する分子の種類と共に、分子配向などの膜構造に大きく依存する。こうした薄膜系の物性を 解明することは、固体表面現象の解明という学術面だけでなく、デバイスへの応用という実用 面においても非常に重要である。本研究で有機薄膜の電子状態の観察や有機/無機からなる系 の界面電子状態の観察などができる電子分光法について紹介するとともに、この方法を用いて 自己組織化単分子膜(Self-Assembled Monolayers: SAMs)の分子配向などについて得た実験結果 を報告する。

キーワード ペニングイオン化電子分光 (PIES), 紫外光電子分光 (UPS) 有機薄膜, 自己組織化膜 (SAM)

1. はじめに

固体表面では原子の並びが途切れているた め、物質内部、すなわちバルクの結晶状態とは 違った新たな物性が潜んでいる可能性がある。 従って、固体表面の研究は、固体物理学、分子 科学、エレクトロニクス、触媒化学、半導体工 学、材料工学など、様々な分野で盛んに行われ て来た。特に、超高真空技術や、エレクトロニ クスの進歩を背景にして、固体表面の状態を調 べる研究手段が次々に登場し、素性がわかった 固体表面についてその構造や性質を詳しく研 究することが可能になった。それによって、固 体表面の物理・化学的性質を原子レベルで理解 する途が開け、固体表面の研究は最近数十年で 飛躍的な発展を逐げたのである。現在では、電 子分光法、イオン分光法、回折法(イオン、原 子、電子などを用いる)、顕微鏡法などを用い た多くの表面分析装置が開発されている。しか し表面が関与する現象には現在でも未知な部 分が多く残されている。その主な原因の一つは 表面現象の鍵を握る、表面最上層の電子状態を 選択的に観測することが容易でないことであ る。表面の電子構造を解析する方法としては、 光電子分光、電子エネルギー損失分光、オージ ェ電子分光などが知られている。しかしこれら の方法では光子や電子を励起源とするため、励 起源が固体内部に浸入するので表面最上層か らの情報と固体内部からの情報を分離するこ とが困難である。このような問題を解決するに は固体表面最上層のみと相互作用するプロー ブを必要とする。

固体表面最上層の電子状態を解析するため、 著者が属した研究室では、Cermack^[1]によっ て開始された準安定励起原子をプローブとす るペニングイオン化電子分光(Penning Ionization Electron Spectroscopy: PIES) を用いている^[2]。まず 1979年に種々の有機 分子の気相のペニングイオン化スペクトルを 測定すると、分子軌道の空間的な広がりに関す る情報が得られることがつきとめられた^[3]。 PIES のこの特徴は分子軌道の立体電子分布や 反応性の研究に応用された^[2]。また、PIESを 固体表面の研究に応用すると、他の手法には見 られない次のような特徴が現れる。

①PIES では励起源に準安定励起原子を 用いるため、それが固体内部に浸入しない。 したがって、表面最上層の電子状態を選択的 に研究することができる。

②ペニングスペクトルの相対バンド強 度を解析すると、表面最上層の波動関数の空 間分布を調べることができる。

PIES のこの特徴はこれまでに、金属^[4]、 Si^[5]、グラファイト^[6]などの無機単体結晶 の表面、簡単な分子の吸着表面^[4]、SiO_x^[7] やアルカリハライド^[8]などの絶縁体表面、 有機超薄膜およびLB膜^[9-12]などの研究に応 用されて、多くの有用の情報が得られている。

本研究では、PIES の特徴を自己組織化単分 子膜 (Self-Assembled Monolayer: SAM) の 評価に適用した。この膜は、有機物の溶液に 金属や半導体基板を浸漬するという単純な 方法で作製できるものであり^[13]、従来のLB 膜に比べて、大きく違う点は、基板と有機分 子が化学結合するということである。そのた め、SAM は基板と分子間および分子と分子間 の相互作用がファンデルワールス力のみで ある LB 膜より強固な膜である。この安定性 のため、SAM は応用を意図して注目をあびて いる^[14]。今まで研究された SAM としては、 アルカンチオールが金基板上に形成する膜 [15, 16]、銀基板上に形成する膜 [17]、銅基板上 に形成する膜^[18]、および有機シリコン誘導 体がシリコン酸化膜(Si0,)上に形成する膜 ^[19, 20] などがある。このような膜の機能性を

評価するには、膜を形成する分子の吸着状態、 特に表面最上層にどのような化学種があり、 それがどのように配向しているか、またその 電子状態はどのようになっているかなどを 調べる必要がある。今まで SAM は実験的には IR^[21]、表面ラマン散乱^[22]、エリプソメト リー^[16, 21]、接触角の測定^[15, 16, 21]、XPS^{[16,} ^{21]}、電気化学的測定 ^[16, 23]、低エネルギーHe 回折 ^[24]、電子顕微鏡 ^[25]、原子間力顕微鏡 ^[26]、STM ^[27]、TDS ^[27]などの方法で調べら れてきた。しかし、SAM の微視的な構造、成 長、吸着、脱離過程などに関しては未知な点 が多く残っており、膜の物性に関する情報も 限られている。このような、薄膜表面での物 性は、固体表面現象の解明という学術面だけ でなく、デバイスへの応用という実用面にお いても非常に重要である。

著者が所属したグループでは、固体表面最 上層を選択的に観測できる方法である PIES と表面から数Å領域を検出できる紫外光電 子分光 (UPS)を組み合わせて、SAM表面の電 子状態および表面最上層に存在する化学種 を決定し、膜の構造および分子配向に関して 興味深い知見を得ている。

2. 固体表面解析法

2-1 光電子分光

図 2-1(a)のように物質(T)に十分エネルギ ーの大きい光子を衝突させると電子を放出す る。

$T + h\nu \rightarrow T^{+*} + e^{-}$ (2-1)

ただし、T^{+*}は基底状態また励起状態のイオン を示す。

上式により放出される光電子のエネルギー 分析を行うのが光電子分光 (Photoelectron Spectroscopy: PES) である。光子として紫外 光を利用するものを紫外光電子分光 (Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy: UPS) *、X線を利用するものをX線光電子分光

(X-ray Photoelectron Spectroscopy: XPS) と呼ぶ。本研究では He I 共鳴線(励起エネル ギー21.22 e V)を紫外光電子分光の光源として



(b) PIES

図2-1 紫外光電子分光とペニングイオン化電子分光

用いた。試料にHe I 共鳴線を照射したとき、 (1)で放出される電子の運動エネルギー&は

 $E_{\rm k} = h_V - E_{\rm B} \qquad (2-2)$

で与えられる。ここでhvは既知であり、 E_k は実験で求められるので、束縛エネルギー E_B が得られる。ただし、 E_k は真空準位を基準としている。

2-2 ペニングイオン化電子分光

図 2-1(b)のように、He*(1s2s)などの準安定 励起原子(A*)を試料(T)に衝突させ、放出され る電子をエネルギー分析する方法をペニング イオン化電子分光 (Penning Ionization Electron Spectroscopy: PIES)**、または準 安定励起原子電子分光 (Metastable Atom Electron Spectroscopy: MAES)と呼ぶ^[1]。 この方法では次のような式に示すイオン化過 程において放出される電子の運動エネルギー を分析する。

T+A^{*}→ T^{+*}+ A + e⁻ (2-3) 希ガスの準安定励起原子の種類、励起エネルギ

種類		励起エネルギー(eV)	寿命(s)
He*	21S	20.616	3.8×10 ⁻²
	23S	19.820	4.2×10 ³
Ne*	³ P ₀	16.716	4.3×10 ²
	³ P ₂	16.619	24.4
Ar*	^{зр} о	11.723	44.9
	^з Р ₂	11.548	55.9

表 2-1 希ガスの準安定励起原子









図 2-2 個体表面でHe*の脱縮過程

ーおよび寿命を表 2-1 に示す。図-2(a)に示す ように RI+AN 過程は、He の 2s 軌道の準位と エネルギー的に対応する位置に試料の空準位 がある場合に起こる。この場合、He の 2s 電子 がトンネル効果により試料の空準位に移動し、 He*は He⁺になる。これを共鳴イオン化(RI)と 呼ぶ[図 2-2(a)]。引き続き、試料の一つの電 子が He の 1s 軌道の抜け穴を埋め、もう一つの 電子が真空中に放出される。これをオージェ中 和(AN)と呼ぶ[図 2-2(a')]。

一方、He*の2s軌道のエネルギー準位に対応 する位置に試料の空準位がない場合、または試 料の空準位の空間的広がりが非常に小さい場 合、RI は起こらない。この場合試料の一つの 電子がHeの1s軌道の抜穴を埋め、Heの2s軌 道の電子が真空中に放出される。これをペニン グイオン化(PI)と呼ぶ[図2-2(b)]。

(a) の過程の場合、放出電子の運動エネル ギーEk は次式で与えられる^[2]。

 $E_{k} = E_{i}' - 2(\xi + \phi)$ (2-4) ここで、 E_{i}' は表面近傍での希ガス原子の有効 イオン化エネルギー、 ξ は遷移に寄与する2個 の電子の結合エネルギー(価電子帯の頂上を基 準)の平均値、 φ は表面の仕事関数である(図 2-3)。この場合、試料の2個の電子が脱励起に 関与するため、得られるスペクトルが UPS に対 応しない。AN 過程による電子の放出強度は次 式で与えられる。



図2-3 オージェ中和過程

 $I(E_k) \propto \int |H_{fi}|^2 N(\xi - \Delta) N(\xi + \Delta) d(\Delta)$ (2-5) ここで、 H_{fi} はオージェ遷移の行列要素、 $N(\xi + \Delta) \geq N(\xi - \Delta)$ はそれぞれエネルギー、 $\xi + \Delta$ と $\xi - \Delta$ における表面近傍の状態密度(Δ につい ては図 2-3 を参照)である。

一方、(b)の過程では、*E* は近似的に次式で 表せる。

 $E_{k} = E(He^{*}) - IP$ (2-6) ここで、 $E(He^{*})$ は He^{*}の励起エネルギーである。 この場合、試料の一つの電子のみが脱励起に関 与するため UPS に似たスペクトルが得られる。 これをペニングイオン化スペクトルと呼ぶ。気 体の場合の、UPS と PIES のバンドの対応を図 2-4 に示す。

UPS と PIES で大きく異なる点はバンドの強 度分布であり、二つの方法で得られるスペクト ルのバンド強度を解析することは、PIES にお いて重要である。UPS の強度は通常の光吸収の 場合と同様に、双極子選択則による。これに対 しペニングイオン化の起こる確率は、主に次の 式に依存する^[3]。

 $W \propto |\langle \chi_{2s}(1)\phi_{T}(2)|1/r_{12}|\phi_{E}(1)\chi_{1s}(2)\rangle|^{2}$ (2-7)



図2-4 PIES と UPSのバンドの対応関係

ここで、 χ_{1s} 、 χ_{2s} 、 ϕ_{T} 、 ϕ_{E} のそれぞれは、He*の 1s 軌道、2s 軌道、試料の電子を放出する軌道、 および連続状態の軌道の波動関数である。この 積分の大きさは He*の 1s 軌道の波動関数 れ。と 試料 T の波動関数 の重なりに支配されるの で、一般的にHe*とTの相対距離が減少すると、 それに伴って指数関数的に増加する。したがっ て、WはHe*とTの最接近点で最大となり、こ の位置でペニングイオン化反応の起こる確率 がもっとも大きいと考えられる。He*は T の斥 る PIES のバンド強度は の斥力表面から外側 への広がりに依存する。

2-3 PIES の固体表面への応用

PIES でプローブとして用いる準安定励起原 子は電子や光子の場合と異なり、原子自身が大 きさをもつため固体内部に浸入しない。そのた め、PIES を固体表面の解析に応用した場合、 固体表面最上層に関する情報が選択的に得ら れる。

図 2-5 に現在固体表面の解析に用いられて いる主な電子分光を模式図で示す。これらの方 法の内で、光子を用いる PES[XPS, UPS, 図 2-5(a)]、および電子用いる電子衝撃分光(EIS) とオージェ電子分光 (AES) [図 2-5(b)] では、プ ローブである光子や電子が固体内部に浸入す るため、放出電子の検出深さはその脱出深さ

(b) EIS, AES, LEED (a) PES(XPS, UPS) A (d) INS

(c) PIES

図2-5 固体表面の研究に用いられる電子分光

によって決まり、得られるデータに固体内部の 効果が混じることは避けられない。また、イオ ンをプローブとして用いるイオン中和分光 [INS, 図-5(d)]では、イオンが固体内部に浸入 しないため、固体表面に対して敏感な方法であ るが、固体表面の2個の電子がその過程に関与 するので、得られるスペクトルの解析が複雑に なる。以上に述べた手法に比べ、PIES 図 2-5(c)]では、プローブが固体内部に浸入せず、 かつペニングイオン化(PI)の場合は、得られる スペクトルの解析が容易である、という特徴を 合わせもっている。

準安定励起原子の脱励起が RI+AN 過程によ る場合は、AN の段階で INS と同じ過程が起こ る。よって、スペクトルの解析は複雑になる。 ただし、INS の場合は入射イオンの運動エネル ギーが数 eV と大きいため、スペクトルがぼや けてしまう (broadening 効果)。これに対し、 RI+AN 過程では入射プローブである準安定励 起原子の運動エネルギーが熱運動エネルギー 程度であり、この種の broadening 効果は無視 できるので INS に比べてスペクトル解析が容 易である。

PIES を気相の分子に適用した場合、分子は 準安定励起原子(He*)とランダムな方向で相 互作用するため「図 2-6(a)]、得られるスペク トルのバンドは斥力表面外側の分子軌道の

(a) 気相



図2-6(a) 気相の分子およびPIES

平均的広がりを反映する^[4]。

PIES を固体表面に適用した場合は、二つの 特徴が現れる。その一つは、準安定励起原子は 固体表面から外側へのしみだしの大きい波動 関数と優先的に相互作用するので、PIES のバ ンド強度の解析から、固体表面の波動関数の空 間分布に関する情報が得られることである。固 体表面での吸着子を例にとってこの様子を[図 2-6(b)]に示す。図のように分子がある特定の 配向で吸着した場合、表面の外側に広がった軌 道に基づくバンド強度が強くなる。例えば、分 子 AB が原子 A を上側にして配向した場合、A の外側に張り出した Φ1 軌道に基づくバンドが 強く現れ、原子 B を上側にして配向した場合、 B の外側に張り出した Ø, 軌道に基づくバンド が強くなる。したがって、PIES の各バンドの 帰属がされている場合、吸着分子の配向に関す る情報が得られる^[5]。

次に、PIES のもう一つの特徴として、非破 壊的な解析手段であることがあげられる。高速 の電子、原子、イオンなどをプローブとして用 いる方法では、吸着子が脱離したりプローブが 固体内部に入り込むといった悪影響が考えら れる。これに対し、PIES では通常運動エネル ギーが 0.1eV 以下の準安定励起原子を用いる ので、試料表面を損傷することがない。



図2-6(b) 固体表面の吸着分子およびPIES

以上の特徴から、PIES は固体表面に対して ソフトで鋭敏な解析手段であると言える。PIES をUPS と併用すると、UPS からは表面最上層か ら表面下数層までの情報が得られ、PIES から は表面最上層のみの情報が得られるので、両者 を合わせると、最上層の情報と下層の情報を分 離して得ることができる。したがって、この方 法は無機および有機の固体表面や薄膜の電子 状態の解析に非常に有効な手段を提供する。

(*UPS:紫外光電子分光と紫外光電子スペク トルの両方に同じ略号 UPS を用いる。**PIES: ペニングイオン化電子分光とペニングイオン 化電子スペクトルの両方に同じ略号 PIES を用 いる)。

3.実験

3-1 実験装置の概略

本研究の PIES および UPS の測定に用いた実験装置の概略を図 3-1 に示す。



図3-1 実験装置

この装置は主に準安定励起原子源室(A)、紫外 光源室(B)、電子エネルギー分析室(C)、試料 作製室(D)からなる。(A)~(D)の各部間は ゲートバルブで仕切られ、(B)室を除きそれぞ れ個別に超高真空まで排気することが可能で ある。各部の排気に用いているポンプおよび真 空度を表 3-1に示す。また、この他に(C)室 で得られた電子信号を処理するパルス増幅・計 測器およびマイクロコンピューターからなる 電子計測系がある(本研究で用いる実験装置は 千葉大学工学部の研究室に設置されているも のである)。

3-1.1 準安定励起原子源

図 3-2 に準安定励起原子源の構造図面を示 す。準安定励起原子は一般に、電子衝突、冷陰 極放電、熱陰極放電などの方法で生成されるが、 本研究で用いたのは電子衝突型の準安定励起 原子源である。図の左方向から送り込んだ He ガスは、キヤピラリアレイで方向がそろったビ ームとなり、電子銃のところで、フィラメント とグリッド間で加速された電子との衝突によ って励起される。その際の He 圧は 2~3× 10⁻⁵torr、電子のエネルギーは 80 eV である。 励起された原子には He*(2³S, 19.820 eV)およ びHe*(2¹S, 21.616 eV)の2種類がある。He*(2¹S) は水冷の He 放電ランプである、クエンチラン プ (quench lamp) の光によって脱励起し、 He*(2³S)のみのビームを得ることができる。ク エンチングの機構を図 3-3 に示す。クエンチ ランプ内の He の放電によって He の $2^{1}P \rightarrow 2^{1}S$ 遷移に基づく赤外線(hv=0.602 eV)の発光

表 3-1	各部の排気に用い	っているボン	づおよび真空度
10 24	THORY JALXING THE	100.0002	プロより兵主反

各部	ボンブ	形式	真空度
A	ターボ分子ポンプ	島津製作所:TMP450	$\sim 10^{-9} \mathrm{torr}$
В	高真空油拡散ポンプ		$\sim 10^{-7} \mathrm{torr}$
с	ターボ分子ボンブ イオンボンブ チタンゲッターボンブ	島津製作所: TMP450 日本真空 PST-8AT 日本真空 PGT-6	$\sim 10^{-9}$ torr
D	超高真空油拡散ボンブ チタンゲッターボンブ	Edwards:DIFFSTAK MK.2 160/700(排気速度 7001/s) 日本真空 PGT-6	$\sim 10^{-9} \mathrm{torr}$





図3-3 Quenchingの機構

が生じ、He*(2¹S)のみがこの光を吸収して、2¹P 状態に励起され、He I 共鳴線を放って基底状 態に落ちる。

He*(2¹S)のスペクトルはクエンチングを行 わずに測定した He*(2¹S)とHe*(2³S)の合成スペ クトルから、He*(2³S)のスペクトルを差し引く ことによって得られる。

3-1.2 紫外光源

図 3-4 に UPS 用の紫外光源室を示す。紫外光 としては He の放電によって得られる He I 共鳴 線(21.218 eV)を用いた。図の下側から導入 した He ガスは、陽極と陰極の間の電圧印加に よって石英管内で放電を起こし、上方(イオン 化室方向)に紫外光を放出する。紫外光(21.22 eV)を透過する窓材が使えないこと、および紫 外光を導入するエネルギー分析室(図 3-1 の

(C) 室)内が超高真空である必要があることのため、放電管から流入するガスを除去するのに、差動排気を用いる。差動排気は、油回転ポンプ2段[(RP1)と(RP2)]、液体窒素トラップ付きの油拡散ポンプ1段[DP, RP3]の3段で構成される真空系で行われている。拡散ポンプ(DP)引き口での到達真空度は10⁻⁸torr程度である。

3-1.3 エネルギー分析室

測定する試料をエネルギー分析室 図 3-1(C)]に導入し、紫外光あるいは準安定励起 原子を照射する。試料は紫外光あるいは準安定 励起原子によって電子を放出する。(C)室内に は、半球型電子エネルギー分析器、および電子 増倍管 (Channeltron) が納められている。放 出電子のうち、エネルギー分析器により一定の 運動エネルギーを持つ電子のみが選別され、増 倍管で検出された後、プリアンプとメインアン プで増幅され、パルス計数器およびマイクロコ ンピューターで計数・積算される。計数率は PIES で 10⁴cpm、UPS では 10⁶cpm 程度であり、 スペクトルの全エネルギー範囲を通常の S/N 比で測定するのに要する時間は、PIES では 30 ~80 分、UPS では 10~20 分程度である。試料 表面に対する準安定励起原子あるいは紫外光 の入射角度は 30°、放出電子の検出角度は 60°(図 3-5)である。また、電子レンズを含 めたエネルギー分析器全体の半値幅分解能 (Full Width at Half Maximum : FWHM) は約

(Full width at hall Maximum Fwhm) はい 150 mV である。なお、本研究では全ての測定 においてスペクトルの低エネルギー側のカッ









トオフ(放出される電子の運動エネルギー=0 eV)から決めた真空準位をエネルギーの基準に している。

3-1.4 試料作製室

試料作製室[図 3-1(D)]は真空蒸着で試料を 作製するように設計されており、蒸着源と膜厚 が制御できる水晶振動子を用いた膜厚計

(INFICON IC6000)を含む。本研究で用いたSAM 膜の作製は大気中で行い、それを試料作製室に入れ、測定した。

3-2 SAM の作製

3-2.1 基板の作製

本研究で用いた基板は天然マイカを大気中 で劈開し、10⁻⁷torrの真空中で加熱(約300°C) しながら Au を約100~200 nm 蒸着したもので ある。この基板を以下略して、Au/Micaで示す。 回折パータンから Au/Micaでは、Au(111)面か ら反射される強い回折パータンが2 θ = 28.5°付近に観察され、(111)面に配向した多 結晶膜ができていることが確認できる。

3-2.2 SAM の作製

SAMの中でメルカプト(-SH) 基を有する有 機物がAu, Agのような不活性金属上で形成す る 膜は、最近盛んに研究されている。







図 3-7 本研究で取り扱ったアルカンチオール分子↔

このような有機物は SH 基と金属間の化学反応 および分子間の相互作用により、秩序のある安 定な膜を形成する。作製方法でもっともよく使 われているのは湿式法(溶液浸漬法)である。 膜形成の模式図を、図 3-6 に示す。

本研究では、自己組織化単分子膜を主に溶液 浸漬法(湿式法)で作製した。すなわち、有機 物試料の薄い溶液を調製し、その溶液に基板を 浸漬して SAM を得た。

基板は Au/Mica である。Au/Mica は、マイ カを大気中で劈開し、 $\sim 10^{-7}$ torr の真空中に入 れ、約 300℃で一晩加熱して清浄化し、金を 100 $\sim 200 \text{ nm}$ 蒸着して作製した。このようにして 作製した基板では、Au(111)面から反射される X 線回折パータンが 2 θ =28.5°付近にはっき り現れ、金の配向性膜ができていることを示す。

举结	御結号	溶液 濃度	浸漬 時間	基板	溶媒
ブタンチオール	C4SH	1mM	5 min	Au/Si(111)	エタノール
		0.1 mM	10 s		
ヘキサンチオール	C6SH	1mM	1 h	Au/Mica	エタノール
ドデカンチオール	C12SH	1mM	5 min	Au/Si(111)	エタノール
オクタデカンチオー ル	C18SH	1mM	5 min	Au/Si(111)	エタノール
1-メルカプト-8-ブロ モオクタン	BrC8SH	1mM	2 days	AuMica	ヘキサン
1-メルカプト-10-クロ ロデカン	CIC10SH	1mM	1 day	Au/Si(111)	エタノール

表 3-2 アルカンチオール系 SAM の作製条件

アルカンチオールの試料は市販品である(ブ タンチオールとヘキサンチオール、ドデカンチ オールは和光純薬工業株式会社から、オクタデ カンチオールは Aldrich から購入した)。ハロ ゲン化アルカンチオールは合成した^[39]。以 上の試料の薄い溶液を調整し、その中に基板を 一定時間浸漬した後、溶液から取り出してエタ ノールで10分間洗浄した。その後基板を大気 中で乾燥し測定に用いた。本研究で取り扱った アルカンチオール系の試料は図 3-7 に示す 6 種類である。各々の試料の SAM 作製条件などを まとめて表 3-2 に示す。

上述の処理をした基板をマニピユレーター の先端部に固定し、超高真空中に入れ測定に用 いた。試料室の真空度が $1x10^{-7}$ torr になっ たとき、試料を測定室に導入し、PIES と UPS の測定を行った。測定室の真空度は $\sim 10^{-9}$ torr である。スペクトルの測定はまず室温で 行った。次に膜を加熱しながら測定し温度依存 性を調べた。

4. 結果と考察

測定は図3-7に示す6種の試料について行っ ている。今回はその中から代表的な例としてへ キサンチオールと 1-メルカプト-8-ブロモオ クタンの結果について述べる。

4-1 ヘキサンチオール (C₆H₁₃SH)

(省略記号:C₆SH)

図 4-1 に大気に曝した Au/Mica の He*(2³S) PIESとHe I UPSを示す。図 4-2 にヘキサンチ オール (C6SH) SAM の He^{*}(2^{3} S) PIES、 He I UPS と分子軌道計算(MOPAC MNDO)で求めた DOS を比 較して示す。表 4-1 には C6SH のイオン化エネ ルギーの計算値とそれらに対応する分子軌道 の特徴を示す。ただし、分子軌道計算の際には Chem3D により最適化した原子座標を使用し、 分子軌道計算プログラム MOPAC6 を用いた。ま た DOS の曲線を求める際には、分子全体と分子 のある特定部分を選択したものについて、 0.3eVの半値幅で Gaussian broading を行った。 図 4-2 からわかる通り、測定結果と計算結果は よく対応する。図 4-2 は図 4-1 の基板とは明ら かに異なっており、C_eSH 分子が Au/Mica 基板 上に吸着膜を形成しているといえる。







Ionization Energy(eV) 図4-2 C6SH SAMのHe*(2³S) PIES, He I UPS(室温)と分子軌道計算 (MOPAC MNDOで求めたDOS[(a)分子全体, (b)-CH3を選択 したもの]の比較

PIES と UPS を見ると、UPS ではプローブとし て用いる紫外光が膜内部に浸入するためアル キル鎖全体の分子軌道に基づくバンドが観測 されている。一方、PIES では He*原子が膜内部 に浸入しないため、He*が表面最上層に存在す る、ある特定の軌道と相互作用し、それに基づ くバンドP1とP2が強調されて観測されている。 アルキル鎖を構成する原子軌道は炭素の 2p と 2s 軌道、および水素の 1s 軌道であり、これら の原子軌道からなる分子軌道は図 4-3 に示す ように3種類に分類される(分子配向について は、アルキル鎖が基板に対して垂直なものと平 行なものを例にとる)。その一つは炭素鎖骨格 平面に垂直な 2pz軌道と水素の 1s 軌道からな る pseudo- π 軌道である。残りの二つは σ 軌道 であり、一方は炭素の2p軌道と水素の1s軌道 からなる軌道で、他方は炭素の 2s 軌道の寄与 が大きい軌道である。図 4-3 から分子がアルキ ル鎖を基板に垂直にして並んだ場合、He*はσ (2p)軌道(主にメチル基)と有効に相互作用す る、またアルキル鎖を基板に平行にして並んだ 場合、He*は pseudo-π 軌道および σ

表 4-1 C6SH 分子のイオン化エネルギーの計算値

およびそれらに対応する分子軌道の特徴

MO No.	$IP_{\rm cold}/eV^*$	MO character	
22(HOMO)	9.73	ns	
21	11.82	бся	
20	12.25	Geo	
19	12.25	π ен _я	
18	12.31	GCH	
17	12.59	π _{CH2}	
16	13.08	GOH	
15	13.34	пон ₂	
14	15.76	Goo, Goh, (Gah)	
13	14.18	GOH	
12	14.47	GCH	
11	15.00	GCH.	
10	15.65	GHH	
9	15.67	Tich ₂	
8	16.58	ZCH ₂	
7	20.71	S 3s, C 2s	

"MOPAC MNDO による分子軌道計算の結果に基づく



図4-3 He*とn-alkane分子軌道相互作用の模式図

(2s) 軌道と有効に相互作用することが予想 される。これは Ozaki らが n-アルカン系につ いて行った PIES の実験事実で証明されている ^[7]。Ozaki らによれば、一般に長鎖 n-アルカン を室温の金属基板上に蒸着すると、炭化水素鎖

が基板に垂直になった結晶膜が得られ、またグ ラファイト基板上に低温で蒸着すると分子は 横たわって配向する。両者の結果をここで示し た C6SH SAM の PIES と比較すると、分子が基板 に対して垂直に立って配向しているとされる n-アルカンの金属基板上の膜のスペクトルと よく似ており、C6SH、SAMでは、分子はアルキ ル鎖を立てて自己組織化膜を形成していると 考えられる[図 4-5(a)]。図 4-2の PIES では他 のアルカンチオール SAM の PIES と同じよう にバンド P₁と P₂が強調されている^[29]。これ は C6SH 分子の末端のメチル基が He*と有効に 相互作用できることを示しており分子はアル キル鎖を基板に対して立てて配向し、表面最上 層にメチル基が突き出していると言える。この 試料に用いたAu/Mica 基板はSTMの観測による と基板上の銀原子の Au(111) 面が非常に平ら である^[13]。同様な SAM を表面が凹凸になって いる基板 Au(111)/Si 上に作製した場合も実験 結果はほぼ同じである。それにも関わらず両者 で分子は同様な配向をとっている。これは SAM において分子配向を支配するのは下地よりも アルキル鎖同士の相互作用であることを示す。 図 4-4 と図 4-6 に C6SH SAM の He^{*}(2^{3} S) PIES と He I UPS の温度依存性を示す。まず PIES に注目すると、他の SAM の場合と同じように 加熱によって、バンド P1と P2の両側にバンド P'と P"がはっきり現れて来ることがわかる。 これは他の SAM でも証明されているように分 子のアルキル鎖の横腹にある pseudo-π軌道 がHe*と相互作用するようになってきたことを 示しており、室温で基板に対して垂直に配向し ていた分子が基板側に傾いてきたことを示す 「図 4-5(b)]。膜を加熱して温度を上昇さて行 くと、150℃ではスペクトルが大きく変化し、 温度をさらに上げるとブロードなスペクトル になる。また UPS では加熱によって室温ではは っきり見えていない下地の金の 5d 軌道に基づ くバンドが明瞭になり、300℃では綺麗な金の スペクトルが得られる。一般的には大気にさら した金基盤を加熱によって清浄化しても金の 5d 軌道に基づくバンドがこれほどはっきり現 れない。このスペクトル変化から C6SH 分子



図 4-5 C6SH SAM の分子配向,(a)室温,(b)加熱中...

の吸着と脱離により基板表面で表面清浄化が 起こっていることがわかる。金の PIES がブロ ードになっているのは前述した様に金属表面 でペニングイオン化が起こらず、共鳴イオン化 とそれに引き続くオージェ中和^[12]が起こっ ているためである。

4-2 1-メルカプト-8-ブロモオクタン (BrC_sH₁₆SH)

(省略記号:BrC8SH)

図 4-7 に気相で測定した BrC8SH 分子の He*(2³S) PIES と HeI UPS を示す。スペクトルの 横軸はイオン化エネルギー(窒素のイオン化エ ネルギーを標準にして補正した値)、縦軸は検 出強度を示す。UPS の運動エネルギーの横軸が PIESに比べて1.4 eV ずれているが、これはUPS と PIES の励起エネルギーの差(21.22 eV と 19.82 eV)を考慮したためである。図 4-7 のスペ クトルにはバンド1~11が観測されている。こ れらのバンドを帰属する目的で BrC8SH につい て行った、MOPAC MNDO による分子軌道計算の 結果をスペクトルと比較して図 4-8 に示す、同 様な計算を Gaussian STO-6G 基底による ab initio 分子軌道計算法でも行い結果をスペク トルと比較している。分子軌道計算の際には Chem3D により最適化された原子座標を使用し た。なお、これらの図において、DOS 曲線を求 める際には、分子全体と分子のある特定部分を 選択したものについて、半値幅 0.3 eV で Gaussian broading を行った。このようにして 求めた DOS をバンドの帰属の参考にした。また イオン化エネルギーの計算値およびそれらに 対応する分子軌道の特徴を、表 4-2 に示す。

図 4-8 で実験で得たスペクトルと分子軌道 計算結果を比較すると、低イオン化エネルギー 側の幾つかのバンドはよく対応するが、イオン 化エネルギーが大きい方では対応がよくない。 このためスペクトル(図4-7)の1~11バンド の帰属は既に報告されている n-ブチルクロラ イドと n-プロピルチオアルコールの UPS^[8]、 および長鎖 n-アルカンの UPS と PIES^[7]などを 参考にして行った。その結果を表 4-3 に示す。

図 4-7 の PIES と UPS を比較すると、各バン ドの相対強度は若干違っている。特に PIES で バンド 1~3 が他のバンドに比べて非常に強調さ



図4-6 C6SH SAMのHe I UPSの温度依存性



図4-7 気相のBrC8SH分子の He*(2³S) PIESと He I UPS

れている。その理由はこれらのバンドは硫黄と 臭素の非結合性軌道 ns と nsr に基づいているた めである。n_sと n_{Br}は空間的な広がりが大きい S 3p と Br 5p の原子軌道によるため He*と有 効に相互作用し強いバンドを与えるのである。 図 4-9 の (a)、(b)、(c) に BrC8SH SAM の He*(2³S) PIES、He I UPS、および気相の BrC8SH のHe*(2³S) PIES を比較して示す。図 4-9 にお いて (b) の横軸を (a) のそれに比べて 1.4 eV 低エネルギー側にずらした。これは UPS と PIES の励起エネルギー差(21.22eVと19.82eV)を 考慮したためである。また、(c)を(a)のそ れに比べて 1.1eV 高エネルギー側にずらした。 このようにすれば気相のスペクトルのバンド と SAM のスペクトルのバンドを直接対応させ ることができる。この 1.1eV のエネルギー差は イオン化の際のAuの電子とBrC8SH分子の電子 の緩和効果に基づく。なお、この SAM の XPS では吸着分子に基づくバンドが弱いながらも 観測されている。また、ここでは XPS の結果の 詳細を省略するが、金基板の各バンドの減衰の 程度 [15] から単分子層膜ができているといえ る。

図 4-9 の SAM の UPS には A-E の 5 つのバンド とバンド X が現れている。バンド X は気相のス ペクトルでは存在しないバンドであり、現段階 ではそれを Au 5d と S 3p AO の相互作用に起因 すると考えている。A-E のバンドは気相のバン ドと対応しており、バンド A を気相のバンド 2

 $(n_{Br}) と 3 (n_{Br}) に、B をバンド 6 (\sigma_{CBr}) に、$ $C をバンド 9 (末端-CH2Br の <math>\sigma$ CH) に、D をバ ンド 10 (π CH2) に、E をバンド 11 (C2s) にそ れぞれ関連させることができる。UPS では光子 が膜内部に浸入するため放出電子はアルキル 鎖全体に関連するものであり、また基板の影響 も強く受ける。したがって、分子配向に関する 有用な情報は得られない。

BrC8SH SAMのPIESでは、SAMのUPSのバンドA, B, Cに対応するバンドA', B', C'が強調されて現れている。この3のバンドはそれぞれ気相の2(n_{Br})と3(n_{Br})、6(σ_{CBr})、および9(末端-CH₂Brの σ_{CH})の各バンドに関



図4-8 気相のBrC8SH分子のHe*(2³S) PIES, He I UPSと分子軌道計算 (MOPAC MNDO)で求めたDOS(a)分子全体,(b)-CH₂Brを選択 したもの]の比較

表 4-2 BrC8SH 分子のイオン化エネルギーの計算値

およびそれらに対応する分子軌道の特徴

MO No.	$IP_{cald.}/eV^{\ast}$	MO character	
31(HOMO)	9.77	ns	
30	11.49	n_{Br}	
29	11.49	n_{Br}	
28	11.88	$\sigma_{\rm CS}$	
27	12.32	$\sigma_{CC}, \sigma_{CBr}$	
26	12.38	π_{CH_2}	
25	12.39	σ_{CH}	
24	12.61	π_{CH_2}	
23	12.90	σсн	
22	13.02	π_{CH_2}	
21	13.36	ocbr, occ, och	
20	13.73	π_{CH_2}	
19	13.80	σcc, σsh	
18	14.42	$\sigma_{\rm CC}, \sigma_{\rm CBr}, \sigma_{\rm CH}$	
17	14.66	π_{CH_2}	
16	14.95	σcc	
15	15.24	$\sigma_{\rm CC}, \sigma_{\rm CH}$	
14	15.61	π_{CH_2}	
13	15.75	OSH	
12	16.73	π_{CH_2}	
11	16.91	π_{CH_2}	
10	20.76	S 3s, C 2s	

'MOPAC MNDO による分子軌道計算の結果に基づく。



図4-9 BrC8SH SAMの(a)He*(2³S) PIES, (b)He I UPS および (c)気相のBrC8SHのHe*(2³S) PIES

表 4-3 BrC8SH 分子のイオン化エネルギーの測定値

Band	$IP_{obs.}/eV^{\star}$	MO character
1	9.10	ns
2	9.98	nBr
3	10.26	n_{Br}
4	10.90	π_{CH_2}
5	11.54	σcs
6	12.09	$\sigma_{\rm CBr}$
7	12.83	π_{CH_2}
8	14.30	$\sigma_{\rm CC}$, $\pi_{\rm CH_2}$
9	15.48	осн
10	16.22	π_{CH_2}
11	18.60	C 2s

*垂直イオン化エネルギー。





連している。したがって、He*は末端の-CH₂Br と有効に相互作用しているといえる。一方、気 相のバンド1 (n_s) とアルキル鎖の横腹にある pseudo- π 軌道 10 (π CH2) に関連するバンド は現れていない。これらのことから BrC8SH 分 子は図 4-10(a)に示すように Au/Mica 基板上で -CH₂Br 基を表面側に出して、アルキル鎖を基 板表面に対して立てて配向していることがわ かる。このような分子配向においては He*は n_{Br}、 σ_{CBr} および-CH₂Br の σ_{CH} と有効に相互作用でき るため対応するバンドが PIES で強くなるので ある。

次に BrC8SH SAM の温度依存性について述べ る。図 4-11 に He^{*}(2³S) PIES の温度依存性を、 図 4-12 に He I UPS の温度依存性を示す。まず、 PIES に注目する。PIES では加熱中に 50°C で n_{Br} に関連するバンド A'が弱くなり始め、アルキ ル鎖の横腹の pseudo- π 軌道に基づくバンド 4'(π CH2)と 10'(π_{CH2})が強くなってくる。 また、 σ_{CS} に基づくバンド 5'とバンド X も見 えてくる。このようなスペクトル変化は加熱に



図4-12 BrC8SH SAMのHeIUPSの温度依存性

より物理吸着した分子が脱離し、化学吸着した 分子のまわりに一定の隙間ができ、それに伴っ て吸着分子が傾いてくるためである。分子が基 板に対して平行に並んだ場合を模式的に図 4-10(b)に示すが、このような配列の場合 He* が相互作用できる分子軌道の数は多くなり、ス ペクトルの構造も複雑になる。しかし、分子全 体で見れば He*ともっとも有効に相互作用でき るのはアルキル鎖の腹の部分の pseudo-π 軌 道である ^[7]。図 4-11 のスペクトルで 50℃か らバンド4'と10'が強くなってきたのは、分 子が pseudo-π 軌道を表面に露出してきたこ とによるといえる。それに伴い n_{Br}に関連する バンドA'は弱くなる。ここで加熱によりバン ドXとバンド5'がはっきり現れてきたことは 多量の物理吸着した分子が脱離したことを示 す。なぜならば、これらのバンドに対応する分 子軌道はアルキル鎖の頭部にある硫黄が化学 吸着して生じた Au-S 結合に関連するものであ り、多量の分子が脱離しない限り He*と有効に 相互作用できないからである。なお、BrC8SH SAM に関しては、物理吸着の存在を XPS で確認 している。図 4-11 で基板温度を 80℃まで上げ ると、スペクトルが大きく変化し、分子はさら に傾く。この温度で長時間加熱してもスペクト ルはほとんど変化しない(図 4-11 を参照)。こ れはこの温度で表面に残っている分子は化学 吸着した分子であり、それが傾いてかなり安定 な構造になったためだといえる。加熱による分 子配向の変化を模式的に図 4-13 に示す。

図 4-11 からわかる通り 110℃からのスペク トルの変化速度は遅く、210℃で 15h の加熱に よって化学吸着した分子はほとんど脱離し、表 面に部分的に硫黄と少量の炭化水素が残る ^[12]。この温度で現れている X バンドは表面に 残った硫黄の S 3p と Au 5d A0 の相互作用に基 づくものである。なお、図 4-11 の PIES は図 4-1 の大気に曝した基板の PIES と明らかに違 ってあり、ブロードで構造がない。これは、ペ ニングイオン化過程が起こらず、He*原子が金 属表面で共鳴イオン化とそれに引き続くオエ ージェ中和過程を通って脱離していることを 示す^[13]。



図 4-13 BrC8SH SAM 分子配向の温度依存性

図 4-12 の UPS では加熱により、Au の 5d AO に よるバンドがはっきり現れてくる。このような はっきりした Au の 5d AO に基づくバンドは大 気に曝した Au の基板を超高真空下で加熱した 場合は現れない。このことは金表面で分子の吸 着・脱離により表面清浄化が起こっていること を示す。

5. まとめ

アルカンチオールおよびハロゲン化アルカ ンチオールが金基板上に形成する自己組織化 単分子膜(SAM)の表面最上層の電子状態およ びその構造を PIES と UPS によって測定し、そ れに基づいて膜の構造と分子配向を評価した。 アルカンチオールおよびハロゲン化アルカン チオール SAM では、それぞれ膜表面最外層にメ チル基およびハロゲン原子(Br)が存在し、分子 自身はメチル基とハロゲン原子を上側にして、 アルキル鎖を基板に対して立てて配向してい

ることが確認できた。ハロゲン化アルカンチオ ール SAM では膜の密集度はシラン系の SAM に比 べて高い。これらの SAM の温度依存性を調べた 結果、加熱によって、最初に物理吸着した分子 が脱離し、それに伴って分子が傾くことがわか った。また温度の上昇によって、化学吸着した 分子が脱離する過程に関する詳しい情報を得 ることもできた。さらに、分子の自発的な吸着 および脱離による固体表面の清浄化が確認で きた。また、今回紹介した PIES は UPS と合わ せて実験を行うことで固体表面上の分子の状 態や化学反応などを分析ができる有効な方法 であると言える。上述のような有機分子を薄膜 状態で調べ、薄膜の構造や分子配向などに関す る情報を得ることは、ナノスケール構造を自己 組織的に形成することや意図的に構造を制御 した集合体を造ることの基本となる。こうした 薄膜系の物性を解明することは、固体表面現象 の解明という学術面だけでなく、デバイスへの 応用という実用面においても非常に興味深い と言える。

6. 参考文献

[1] V. "ermák, J. Chem. Phys. 44, 3781 (1966).

[2] Y. Harada, S. Masuda, and H. Ozaki, Chem. Rev., <u>97</u>, 1897 (1997).

[3] T. Munakata, K. Kuchitsu, and Y. Harada, Chem. Phys. Lett., <u>64</u>, 409 (1979); T. Munakata, K. Kuchitsu, and Y. Harada, J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. <u>20</u>, 235 (1980).

[4] W. Sesselmann, B. Woratschek, J. Kuppers, G. Ertl, and H. Habberland, Phys. Rev., <u>B35</u>, 1547 (1987).

[5] H. Ishii, S. Masuda, and Y. Harada, J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. <u>52</u>, 127 (1990).

[6] S. Masuda, H. Hayashi, and Y. Harada, Phys. Rev., <u>B42</u>, 3582 (1990).

[7] H. Ishii, S. Masuda, and Y. Harada, Sur. Sci., 239, 222 (1990).

[8] T. Munakata, T. Hirooka, and K. Kuchitsu, J. Electron Spectrosc. Relat Phenom. <u>18</u>, 51 (1980).

[9] Y. Harada, H. Ozaki, and K. Ohno, Phys. Rev. Lett., <u>52</u>, 2269 (1984).

[10] H. Ozaki and Y. Harada, J. Am. Chem. Soc., 109, 950 (1987).

[11] H. Ozaki and Y. Harada, J. Am. Chem. Soc., <u>112</u>, 5735 (1990).

[12] H. Ozaki and Y. Harada, J. Am. Chem. Soc., 109, 949 (1987).

[13] W. C., Bigelow, D. L. Pikkett, W. A. Zisman, J. Colloid Interface Sci.,<u>1</u>, 513 (1946).

[14] A. Ulman, Chem. Rev., 96, 1533 (1996).

[15] C. D. Bain, E. B. Troughton, Y.-T. Tao, J. Evall, G. M.

Whitesides. R. G. Nuzzo, J. Am. Chem. Soc., <u>111</u>, 321 (1989).

[16] M. D. Forter, T. B. Bright, D. L. Allara, C. A. D. Chidsey, J.

Am. Chem. Soc., <u>109</u>, 3559 (1987).

- [17] A. Ulman, J. Mat. Ed., <u>11</u>, 205 (1989).
- [18] K. R. Stewart, G. M. Whitesides, H. P. Godfried, I. F. Silvera,
- Sur. Sci. <u>57</u>, 1381 (1986). [19] J. Sagiv, J. Am. Chem. Soc., <u>92</u>, 92 (1980).

[20] S. R. Wasserman, Y.-T. Tao, J. Evall, G. M. Whitesides, Langmuir, <u>5</u>, 1074 (1989).

[21] R. G. Nuzzo, L. H. Dubois, D. L. Allara, J. Am. Chem. Soc., <u>112</u>, 558 (1990).

[22] A. Ulman, S. D. Evans, Y. Shnidman, R. Sharma, J. E. Eilers,J. C. Chang, J. Am. Chem. Soc., <u>113</u>, 1499 (1991).

5.0.011 mm

[23] H. O. Finklea, S. Avery, M. Lynch, T. Furtsh, Langmuir, <u>3</u>, 409 (1987).

[24] N. C. III, C. E. D. Chidsey, G. Liu, T. M. Putvinski, G. Scoles, J. Am. Chem. Soc., <u>94</u>, 8493 (1991).

[25] L. H. Dubois, B. R. Zegarski, R. G. Nuzzo, J. Chem. Phys., <u>98</u>, 678 (1991).

[26] C. A. Alves, E. L. Smit, M. D. Porter, J. Am. Chem. Soc., <u>114</u>, 1222 (1992).

[27] M. Hara, K. Tamada, C. Hahn, N. Nishida, W. Knoll, Supramolecular

Science <u>3</u>, 103 (1997).

[28] 原 正彦、私信.

[29] A. Abdureyim. 学位論文、第4章

Characterization of Organic Thin Films by Penning Ionization Electron Spectroscopy

Abuduaini ABDUREYIM

2016年2月

新潟產業大学経済学部紀要 第46号別刷

BULLETIN OF NIIGATA SANGYO UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS

No.46 February 2016